

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成27年5月28日(2015.5.28)

【公開番号】特開2015-71530(P2015-71530A)

【公開日】平成27年4月16日(2015.4.16)

【年通号数】公開・登録公報2015-025

【出願番号】特願2014-181852(P2014-181852)

【国際特許分類】

C 01 B 33/04 (2006.01)

【F I】

C 01 B 33/04

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月8日(2015.4.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

金属元素の含有量が0.01～100ppbであることを特徴とする高純度シクロヘキサシラン。

【請求項2】

ナトリウムの含有量が0.01～100ppbである高純度シクロヘキサシラン。

【請求項3】

不純物を含む水素化シラン化合物から金属元素の含有量が0.01～100ppbである高純度水素化シラン化合物を得る製造方法であって、高純度水素化シラン化合物が、下記式(1)

(SiH₂)_n … (1)

(式(1)中、nは3～6である。)

または下記式(2)

Si_mH_{2m+2} … (2)

(式(2)中、mは3～6である。)

で表され、少なくとも、条件の異なる蒸留工程を2回以上行うことの特徴とする高純度水素化シラン化合物の製造方法。

【請求項4】

短行程蒸留、薄膜式蒸留、分子蒸留のいずれかによる第1蒸留工程と、蒸留塔での第2蒸留工程を行う請求項3に記載の製造方法。

【請求項5】

第1蒸留工程を25～80で行い、第2蒸留工程を第1蒸留工程より高温で、かつ、50～100で行う請求項3または4に記載の製造方法。

【請求項6】

第1蒸留工程を3kPa～10kPaで行う請求項4または5に記載の製造方法。

【請求項7】

クロムの含有量が0.01～10ppbである高純度シクロヘキサシラン。

【請求項8】

カリウムの含有量が0.01～10ppbである高純度シクロヘキサシラン。